

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 9 月 7 日(07.09.2012)



(10) 国際公開番号

WO 2012/117990 A1

- (51) 国際特許分類:
C09D 183/16 (2006.01) C09D 1/00 (2006.01)
B32B 27/00 (2006.01) C09D 7/12 (2006.01)
C08G 77/62 (2006.01) G02B 1/11 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/054705
- (22) 国際出願日: 2012 年 2 月 27 日(27.02.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-043904 2011 年 3 月 1 日(01.03.2011) JP
- (71) 出願人 (アルバニア, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェッコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リトアニア, ルクセンブルグ, ラトヴィア, モナコ, マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国, マルタ, オランダ, ノールウェー, ポーランド, ポルトガル,

カタール, ルーマニア, セルビア, ルワンダ, スウェーデン, スロヴェニア, スロヴァキア, サン・マリノ, トルコ, 米国を除く全ての指定国について): AZ エレクトロニックマテリアルズ株式会社 (AZ ELECTRONIC MATERIALS (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込 2 丁目 2 番 8 号文京グリーンコート Tokyo (JP).

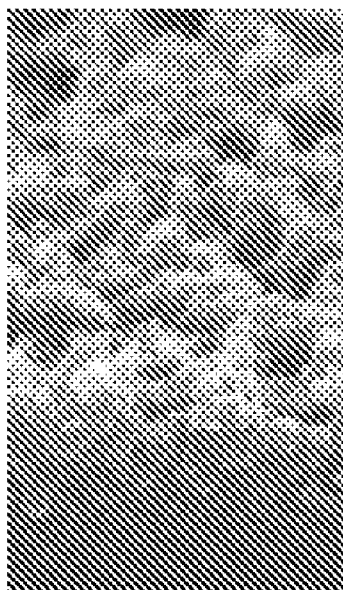
(71) 出願人 (アルバニア, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェッコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リトアニア, ルクセンブルグ, ラトヴィア, モナコ, マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国, マルタ, オランダ, ノールウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, セルビア, スウェーデン, スロヴェニア, スロヴァキア, サン・マリノ, トルコについてのみ): エイゼット・エレクトロニック・マテリアルズ・ユーエスエイ・コーポレーション (AZ ELECTRONIC MATERIALS USA Corp.)

[続葉有]

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING LOW-REFRACTIVE-INDEX FILM, METHOD OF FORMING LOW-REFRACTIVE-INDEX FILM, AND LOW-REFRACTIVE-INDEX FILM AND ANTIREFLECTIVE FILM BOTH FORMED BY THE FORMATION METHOD

(54) 発明の名称: 低屈折率膜形成用組成物、低屈折率膜の形成方法、及び該形成方法により形成された低屈折率膜並びに反射防止膜

[図1]



(57) Abstract: Provided is a composition for forming a low-refractive-index film, which exhibits an excellent antireflective function even when applied in a single layer and does not affect the environment, and which is characterized by comprising (A) an inorganic polysilazane and (B) at least one organic polymer selected from a silazane-containing organic polymer, a siloxazane-containing organic polymer and a ureasilazane-containing organic polymer, wherein the ratio (A): (B) is 40:60-17:83 by weight.

(57) 要約: 単層でも優れた反射防止機能を有し、且つ、環境に影響を与えない、(A) 無機ポリシラザンおよび (B) シラザン含有有機重合体、シロキサザン含有有機重合体、ウレアシラザン含有有機重合体から選ばれる少なくとも 1 種の有機重合体を含み、(A) : (B) の重量比が 40 : 60 ~ 17 : 83 であることを特徴とする低屈折率膜形成用組成物を提供する。



[US/US]; 08876 ニュージャージー州 サマービル、マイスター・アベニュー、70 New Jersey (US).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 尾崎 祐樹 (OZAKI Yuki) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズ株式会社内 Shizuoka (JP).

(74) 代理人: 鐘尾 宏紀, 外 (KANAOKI Hiroki et al.); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町2-10-14 ぱんだいビル2階 かなえ国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,

LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロピア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))